

(Korea)

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.





EV 그룹이 다기능 파이크로 및 나노임프린트 충루션 EVG7300을 중사됐다

서울~(뉴스와이이) 2022년 01월 19일 ~ MEMS, 나노 기술, 번도제 제조용 웨이퍼 본당 및 리소그래피 장비의 선도적 공급사인 당기 급인이하 EMG이 자동화된 SmartNIL하 나노임프린트 및 웨이퍼 레텔 광학 시스템인 EMG#3200은 실시한다고 19일 밝혔다.

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노업프린도 리소그라파(NIL), 렌즈 용당 및 렌즈 스테링(UV 본당) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫동에 급성한 것이 특징이다. 이 산업을 다가능 시스템은 마이크로 및 나노 페터닝은 물론, 기능 레이어 작중 등을 포함하는 광범위한 신규 매플리제이션의 럼단 R&D와 성신 궁정 모두 매 사용될 수 있다.

이런 애플리케이션의 사례에는 웨어퍼 레텔 광학(WLO), 광학 센서와 프로젝터, 처랑용 조명, 중강 현실(AR) 해 도 첫용 웨이브가이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면, 광전자 기기 등이 포함된다. 취대 300mm 웨 이희까지 지원하고 고정말 일라인전트, 항상된 프로세스 제어, 우수한 쓰루풋 성능을 자랑하는 EVG7300은 다 양한 자유도와 높은 정말도로 나노 및 마이크로 광학 부종과 기기를 대량 생산하려는 사용자의 모구를 충족한 다

EV 그룹의 보다스 글린스니(Thomas Glimsner) 기술담당 다렉터는 "나노인프린트 가술에 있어 20년 이상의 경 업을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나온 울루선을 재궁하고 있다. 청신 나노업프린트 솔루션인 EVG7300은 EVG 교유의 Smarthul 플-램드 임프린트 기술에 변츠 담당과 연조 스테션을 단엄 플랫폼에 점합하고 있으며, 시장에서 가장 정말한 임라인언트와 긍정 파라미터 제 이가 독칭인 시스템으로서 교객이 연구개발과 양신 공정 모두에 사용할 수 있도록 유례성는 유연성을 제공한

EVG7300은 독립된 플로서 사용하거나 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 출주선에 하나의 모듈로 중합해 사용 할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 출주선은 사용자의 특정 프로세스 모건에 따라 사정과 레지스트 교팅 및 베이킹 같은 전처럼 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 함께 선도적인 원라인 언트 정확도를 제공한다(300mm까지). 이는 항상된 원라인언트 스테이지, 교정일 광학계, 멀티모언트 캠 제어, 비점속식 캠 측정, 멀티로엔트 포스 제어 등 다양한 방림의 조합 덕분에 가능해졌다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫동으로서 세 가지 공정 모드(현조 물당, 현조 스태킹, SmartNIL 나 노인프린트)를 진원하고, 150mm구터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신호한 스탠프 와 웨이퍼 로당, 고속 일라인언트 광학제, 고전력 경화, 소영화단 물 굿프린트로 업계에서 세움게 떠오르는 WLO 제공의 제조 요구를 중작하는 매우 효율적인 플랫동물 제공한다.